明　細　書

発明の名称 ： 履物

技術分野

[0001]　本発明は、草履やサンダルのような足首から下方が開放される履物に関するものである。

背景技術

[0002]　草履やサンダルのような足首から下方が開放された開放式履物は、一般に、足裏の形をした平板状の足底に、ベルトや鼻緒を取り付けることによって構成されている。また、従来、足底に突起を設け、歩行しながら足裏のつぼを刺激したり、足底を横方向に傾斜させてＯ脚やＸ脚を補正したりする、といった健康によい機能を有する草履やサンダルが普及している。

[0003]　そこで、出願人は、特許文献１に記載された技術を提案した。特許文献１には、使用者の足が載せられる足台における、少なくとも使用者の足の中指、薬指、小指及びこれらの付け根部分と、当該付け根部分に対して踵寄りに位置する母趾内転筋横頭の部分とに対向する部位、及び踵に対向する部位を欠落させた履物が開示されている。この履物によれば、使用者が履いて歩行した場合、足裏におけるつま先側でかつ外側の部位が地面から離間するため、使用者の体重は、使用者の足裏の内側側部に集中する。これにより、使用者の脚の重心を内側に補正することが可能になり、使用者がＯ脚であれば、使用者の膝の間隔を狭くすることが可能になるとともに、使用者はつま先立ちで歩くような格好になり、履物を履いて歩くことよって、自然にふくらはぎ、太腿の裏から尻にかけての筋肉を鍛錬することが可能になる。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：特許第７１６６０３５号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] ところで、ハイヒールのような踵の高い履物に履いている者は、重心が比較的前方にあるため膝が前方に位置し易くなり、これにより、足首が内側に傾き、膝が内側に入る、言い換えれば膝が内側にねじれ易くなる傾向にある。このような状態が長時間継続すると、骨盤が拡がって、所謂、Ｘ脚になるおそれがあり、しかも、首の骨が真っ直ぐな状態で固定化してしまうという、所謂、ストレートネックになるおそれがある。このように、踵の高い履物に履くことによって、骨格に歪みが生じ、脚や首に痛みを感じるおそれがある。

[0006] 本発明は、このような問題点に対して鑑みなされたものであり、姿勢を補正する機能を有する履物を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0007] 前記目的を達成するため、本発明は、次に記載する構成を備える。

[0008] ［１］本発明の態様は、足が載せられる足台（１０）を備え、前記足台（１０）は、使用者の踵に対向する部位の厚さを薄くした踵薄肉部（１２ａ）と、使用者の小指側に対向する部位の厚さを薄くした小指側薄肉部（１２ｂ、１１ｆ）と、前記踵薄肉部（１２ａ）及び前記小指側薄肉部（１２ｂ、１１ｆ）を除いた部位に形成され、使用者の足裏が載せられる載置部（１１ｂ）と、を有する履物であって、

前記小指側薄肉部（１２ｂ、１１ｆ）は、小指側平坦部（１２ｂ）と下り傾斜部（１１ｆ）とからなり、

前記小指側平坦部（１２ｂ）は、使用者が履物を履いた状態において、少なくとも使用者の足の薬指、小指及びこれらの付け根部分と、当該付け根部分に対して踵寄りに位置する母趾内転筋横頭の部分が対向する部位であり、

前記下り傾斜部（１１ｆ）は、使用者が履物を履いた状態において使用者の足裏の小趾外転筋が対向する部位であり、前記載置部（１１ｂ）の上面から前記小指側平坦部（１２ｂ）の上面に向かって下り傾斜しており、かつ、

前記小指側平坦部（１２ｂ）の上面と前記踵薄肉部（１２ａ）の上面とは連続していることを特徴とする。

[0009] ［２］上記［１］の態様において、上記履物が、足の親指と人差し指とによって挟まれる前緒部（２１）及び足の甲にかける横緒部（２２）からなり、前記足台（１０）に取り付けられる鼻緒（２０）を、更に備えることを特徴とする。

[0010] ［３］上記［２］の態様において、前記横緒部（２２）は、足の甲の小指側にかける外側横緒部（２２ｂ）と、足の甲の親指側にかける内側横緒部（２２ａ）とを有し、

前記外側横緒部（２２ｂ）及び前記内側横緒部（２２ａ）は、前記前緒部（２１）から延びて、端部が前記踵薄肉部（１２ａ）に取り付けられる。

[0011] ［４］上記［２］の態様において、前記横緒部（２２）は、前記前緒部（２１）から延びて足の甲の親指側にかけ、小指側にかけないことを特徴とする。

[0012] ［５］上記［４］の態様において、前記横緒部（２２）の端部は、前記載置部（１１ｂ）に取り付けられることを特徴とする。

[0013] 上記［１］の態様によれば、踵の高い履物をいつも履いている使用者が履物を履いた場合に、使用者の足裏における小趾外転筋の部分に、踵薄肉部、小指側薄肉部が対向する。このため、使用者の足裏の外側（小指側側部）が足台の面から離間することにより、足裏の外側（親指側の側部）が下方に移動し易い状態におかれる。そして、使用者の足裏の外側が下方に移動することにより、使用者の膝が外側に開き易くなる。その結果、踵の高い履物を履くことによって内側にねじれている膝を元の状態に戻すことが可能になり、足の骨格を元に戻すことが可能になる。また、使用者が本発明の履物を履いた場合に、足を足台に載せた状態で、踵薄肉部の面に踵を着けることが可能になる。このため、つま先側よりも踵側が低くなるため、使用者の重心を後方に移動させることが可能になり、踵側に体重がかかり易くなる。これにより、前屈みの姿勢を補正することができるとともに、使用者は、歩行の際に、足を足台に載せた状態で踵を上下動させることができるようになり、使用者のふくらはぎ、太腿の裏から尻にかけての筋肉を効率よく鍛錬することが

可能になる。

さらに、使用者が履物を履いた状態で足裏の小指側側部が下方に移動した時に、最初に、下り傾斜部に当接することにより、使用者の足裏の外側が必要以上に下方に移動することを規制することができる。これにより、内側にねじれている膝を元の状態に戻すことが可能になるとともに、歩き易くすることが可能になる。

[0014] 上記［２］の態様によれば、前緒部を足の親指と人差し指とによって挟み、横緒部を足の甲にかけることにより、履物を履くことが可能になる。

[0015] 上記［３］の態様によれば、外側横緒部及び内側横緒部が踵薄肉部に取り付けられているため、使用者が履物を履いて歩行することにより、使用者の足裏と踵薄肉部とが大きく離間することが低減される。これにより、履物を履いて歩行し易くなる。

[0016] 上記［４］の態様によれば、使用者が履物を履いた場合に、使用者の足裏の外側側部が、小指側薄肉部及び踵薄肉部が対向する。このとき、使用者の足裏の外側側部が下方に移動し易い状態になるとともに、使用者の小指側の甲部に掛ける横緒部が無いため、使用者の足裏の外側側部が足台から離れ易くなる。このため、使用者は姿勢を維持しようとして使用者の足裏の土踏まず付近のアーチによって足台をグリップしようとする。使用者が履物を履くことによって、このようなグリップの動きを促すことが可能になり、その結果、使用者の骨格が正常になるような動きに導くことが可能になる。

[0017] 上記［５］の態様によれば、横緒部を親指側の甲に確実にかけることができる。

発明の効果

[0018] 本発明によれば、姿勢を補正する機能を有する履物を提供することが可能になる。

図面の簡単な説明

[0019] [図1]本発明の第１の実施形態における履物の外観を示す斜視図である。

[図2]図１の平面図である。

[図3]図１の側面図である。

[図4]本発明の第２の実施形態における履物の斜視図である。

[図5]図４の平面図である。

[図6]図４の側面図である。

発明を実施するための形態

[0020] 以下に、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。

[0021] ［第１の実施形態］

図１は、本発明の第１の実施形態における履物１の外観を示す斜視図である。図２は、図１の平面図である。図３は、図１の側面図である。履物１は、所謂、ビーチサンダルであり、足台１０と、鼻緒２０と、を備えている。なお、図１～図３は、使用者の左足に履かせる履物１を示しており、右足に履かせる履物１は左足に履かせる履物１に対して左右対称であるため、右足に履かせる履物１についての詳細な説明は省略する。また、説明では、履物１の左右方向において、親指側を内側とし、小指側を外側とする。更に、履物１の前後方向において、つま先側を前側とし、踵側を後側とする。

[0022] 足台１０は、例えばゴム材やＥＶＡウレタン材等によって構成され、上側に配置される第１層１１と、下側に配置される第２層１２との２層構造である。

[0023] 第１層１１は、平面視にて少なくとも部分的に足の外周をかたどった輪郭を有する板状部材である。第１層１１は、踵欠落部１１ａと、載置部１１ｂと、小指側欠落部１１ｃと、下り傾斜部１１ｆと、を備えている。説明の便宜上、実体的な部材の存在しない空間である踵欠落部１１ａ及び小指側欠落部１１ｃも第１層１１の構成要素として扱うが、第１層１１における実体的な部材は、載置部１１ｂ及び下り傾斜部１１ｆである。

[0024] 第１層１１の踵欠落部１１ａは、使用者の踵が対向する部位を欠落させることによって形成される。

[0025] 第１層１１の載置部１１ｂは、使用者の足裏が載せられる部位であり、上

り傾斜部１１ｄと、水平部１１ｅと、を有する。上り傾斜部１１ｄの上面は、使用者の親指、人差し指及びその付け根付近が当接する傾斜面である。水平部１１ｅの上面は、使用者の母趾内転筋横頭から踵の前縁付近までの範囲が当接する水平面である。上り傾斜部１１ｄは、水平部１１ｅの前縁からつま先に向かって板状部材の肉厚を漸次厚くすることによって形成されている。これにより、上り傾斜部１１ｄの傾斜面は、水平部１１ｅの水平面に連続してつま先に向かって上り傾斜する。なお、第１層１１の下面は平面である。

[0026] 一例として、載置部１１ｂの水平部１１ｅの上面から上り傾斜部１１ｄの傾斜面の頂上までの高さＨは、７ｍｍ以上２２ｍｍ以下の範囲で設定することが好ましく、特に、１５ｍｍ以上２０ｍｍ以下に設定することがより好ましい。

[0027] 第１層１１の小指側欠落部１１ｃは、板状部材のつま先側端部の略中央から長手方向に沿って切れ目を入れ、鼻緒２０の前緒部２１に対して若干外側の部位を通り、載置部１１ｂの踵側の縁に対して若干つま先寄りの部位を通って、小指側側部の近傍まで緩やかな弧状に切断し、そこから更に、長手方向に沿って踵欠落部１１ａまで切断することによって形成される。

[0028] 第１層１１の下り傾斜部１１ｆは、足台１０における踵欠落部１１ａと載置部１１ｂと小指側欠落部１１ｃとの間に形成されている。下り傾斜部１１ｆは、載置部１１ｂの上面から第２層１２の上面に向かって下り傾斜している。下り傾斜部１１ｆの麓部分には、第２層１２の小指側平坦部１２ｂの一部である小指側側部１２ｂ１の上面が隣接する。

[0029] 第２層１２は、平面視にて足の外周全体をかたどった輪郭を有する平坦な板状部材である。第２層１２の下面は、波状の凹凸による粗面に形成されている。これにより、第２層１２が、地面に対して滑りにくくなる。第２層１２の上面の一部に、第１層１１の載置部１１ｂ及び下り傾斜部１１ｆの下面が接合されている。第２層１２の踵側平坦部１２ａ及び小指側平坦部１２ｂの各上面は露出しており、これらはそれぞれ第１層１１の踵欠落部１１ａ及

び小指側欠落部１１ｃの各下面に対応する。

[0030] ここで、小指側平坦部１２ｂの一部であって足台１０の外側側面の近傍部分を小指側側部１２ｂ１と称する。小指側平坦部１２ｂの上面と踵側平坦部１２ａの上面とは連続しており、小指側側部１２ｂ１の位置で繋がっている。

[0031] 使用者が足台１０に足裏を載せた場合に、載置部１１ｂに使用者の足裏が当接し、一方、踵欠落部１１ａ、小指側欠落部１１ｃ及び下り傾斜部１１ｆにおいては足裏が足台１０から離間する。下り傾斜部１１ｆには、使用者の足裏の小趾外転筋が対向する。ただし、使用者が足裏を外側（小指側）に傾けた場合に、下り傾斜部１１ｆの下り傾斜面に足裏を当接させることが可能である。

[0032] 第１層１１は、好ましくは上領域３１と下領域３２とからなる２層構造である。上領域３１及び下領域３２は同一の部材によって構成され、平面視した形状が同一である。上領域３１は、厚さが均一な板状部材からなり、上面に使用者の足裏が当接する。上領域３１の上面は、細かい凹凸からなる粗面に形成されている。これにより、使用者の足裏が上領域３１の上面に対して滑りにくくなる。また、上領域３１における踵側の縁、言い換えれば踵欠落部１１ａとの境界となる縁に、面取りが施されている。また、上領域３１における小指側の縁、言い換えれば小指側欠落部１１ｃとの境界となる縁にも面取りが施されている。

[0033] 下領域３２は上領域３１の下面に接着固定される。下領域３２は、下領域水平部３２ａと、下領域傾斜部３２ｂと、からなる。下領域水平部３２ａは、上領域３１における母趾内転筋横頭が当接する部位から踵側の部位が上領域３１を介して対向する部分である。下領域傾斜部３２ｂは、下領域水平部３２ａからつま先側に向かって漸次肉厚となり、上面が下領域水平部３２ａの上面から上り傾斜する部分である。

[0034] 上領域３１の下面を下領域３２の上面に接着固定することによって、上領域３１を下領域３２の上面に沿うように変形させた状態で、第２層１２の上

面に固定することができる。これにより、上領域３１が下領域３２の下領域水平部３２ａ及び下領域傾斜部３２ｂに沿って傾斜して、第１層１１に水平部１１ｅ及び上り傾斜部１１ｄが形成される。

[0035] 上領域３１と下領域３２は、互いに異なる色に着色されている。上領域３１及び下領域３２の色は、互いの色が明瞭に識別できる色であることが望ましい。一例として、上領域３１には黒、下領域３２には白が適用可能である。下り傾斜部１１ｆの傾斜面は、上領域３１から下領域３２に渡って形成されている。

[0036] 足台１０は、第１層１１の下面すなわち下領域３２の下面と第２層１２の上面とを接着することによって作製される。この結果、踵欠落部１１ａ、小指側欠落部１１ｃ、及び下り傾斜部１１ｆによって、第１層１１の上面と第２層１２の上面との間に段差が形成される。

[0037] 言い換えると、第２層１２の踵側平坦部１２ａは、足台１０における踵薄肉部を形成している。すなわち、踵薄肉部１２ａは、足台１０において、使用者の踵に対向する部位であって厚さを薄くした部分である。

[0038] 更に言い換えると、第２層１２の小指側平坦部１２ｂと第１層１１の下り傾斜部１１ｆとは、足台１０における小指側薄肉部を形成している。すなわち、小指側薄肉部は、足台１０において、使用者の小指側に対向する部位であって厚さを薄くした部分である。

[0039] 載置部１１ｂは、複数の周囲壁面によって囲まれている。複数の周囲壁面の一つは、鼻緒２０の終端よりもつま先側において足台１０の内側側面と小指側側部との間に延在する第１壁面１１ｇである。第１壁面１１ｇは、載置部１１ｂと踵欠落部１１ａとを区画する。第１壁面１１ｇは、好ましくは平面視にて踵側に向かって凹の曲線を描いて延在している。これは使用者の踵の前縁に沿った形状である。

[0040] 載置部１１ｂの複数の壁面の別の１つは、載置部１１ｂと小指側欠落部１１ｃとを区画する第２壁面１１ｈである。第２壁面１１ｈは、平面視にて、足台１０のつま先側の端部の略中央から足台１０の長手方向に沿って延び、

前緒部２１よりも外側を通り、更に載置部１１ｂの踵側の縁に対して若干つま先よりの部位を通って、小指側側部の近傍まで弧状に延在している。

[0041] ??下り傾斜部１１ｆは、載置部１１ｂの周囲壁面の一つであり、小指側側部の近傍において長手方向に延在し、第１壁面１１ｇと第２壁面１１ｈとを小指側において連結している。残りの周囲壁面１１ｉは、第１壁面１１ｇと第２壁面１１ｈとを親指側において連結している。周囲壁面１１ｉは、平面視にて第２層１２の輪郭と重なっている。

[0042] 鼻緒２０は、例えば布や合成樹脂によって構成され、前緒部２１と、横緒部２２と、によって構成されている。前緒部２１は、足台１０の板面から上方に延びて、使用者の足の親指と人差し指とによって挟まれる部分であり、第１層１１の上り傾斜部１１ｄに配置されている。横緒部２２は、紐状或いは帯状の部材によって構成されており、前緒部２１の上端部を基端として足台１０における親指側側部に向かって延びる内側横緒部２２ａと、小指側側部に向かって延びる外側横緒部２２ｂと、の２つに分かれている。

[0043] 内側横緒部２２ａ及び外側横緒部２２ｂの終端は、第２層１２に固定される。具体的に、内側横緒部２２ａの終端は、踵欠落部１１ａにおける第１層１１の上面と第２層１２の上面との段差の近傍でかつ親指側側部に固定される。外側横緒部２２ｂの終端は、踵欠落部１１ａにおける第１層１１の上面と第２層１２の上面との段差の近傍でかつ小指側側部に固定される。これにより、使用者が履物を履いて歩行することにより、使用者の足裏と踵欠落部１１ａとが大きく離間することが低減され、履物１を履いて歩行し易くなる。

[0044] 次に、使用者が履物１を履いた状態について説明する。

[0045] 使用者は、鼻緒２０に足を通し、使用者の足の親指と人差し指との間に前緒部２１を挟むことによって履物１を履くことができる。

[0046] 使用者が履物１を履いた状態において、使用者の足の中指、薬指、小指及びこれらの付け根部分と、当該付け根部分に対して踵寄りに位置する母趾内転筋横頭と、短小趾屈筋における土踏まずの側方の部分とが、小指側欠落部

１１ｃに対向する。つまり、足裏を土踏まず付近でつま先側と踵側とに２分割し、このうちつま先側を更に親指側（内側）と小指側（外側）とに分割した場合に、つま先側の外側半分が、小指側欠落部１１ｃに概ね対向する。また、使用者の踵全体が、踵欠落部１１ａに対向する。また、下り傾斜部１１ｆは、土踏まずと踵との境界付近における小指側（外側）の部位に形成されているので、使用者の小趾外転筋の部分が、下り傾斜部１１ｆに対向する。

[0047] すなわち、使用者が履物１を履いた場合に、足裏の小指側側部全体が浮いた状態になるため、足裏の小指側側部が下方に移動し易い状態におかれる。そして、使用者の足裏の外側が下方に移動することにより、使用者の膝が外側に開き易くなる。その結果、膝が内側にねじれている状態を元に戻すことが可能になる。

[0048] このように、第１の実施形態の履物１によれば、特に、ハイヒールのような踵の高い履物に履いている者が履くことにより、重心を後方に移動させることができるとともに、膝の内側のねじれを元に戻すことが可能になる。また、膝の内側のねじれを元に戻すことにより、拡がった骨盤を元に戻すことができる。骨盤は、仙骨を通じで背骨にも繋がっており、重心を後方に移動させることによって、背骨を本来のＳ字状で戻すことが可能になる。背骨が正常な状態に戻ると、頭の位置が背骨のラインに沿うようになり、首の骨が前傾状態から元に戻るようになり、ストレートネックが矯正される。その結果、骨格の歪みが元に戻るようになり、脚や首の痛みを低減することができる。

[0049] なお、ストレートネックになると、頭蓋骨を包んでいる薄い筋膜が上に突き上げられた状態になってしまうため、それによって表情筋が弛んでしまい、顔全体が弛んだ感じになってしまう。第１の実施形態の履物１によれば、首の骨をストレートネックから正常な状態に戻すことにより、顔の弛みをとり、小顔にする効果が期待できる。

[0050] また、使用者の足裏の外側が下方に移動した時に、最初に、下り傾斜部１１ｆに当接することにより、使用者の足裏の外側が必要以上に下方に移動す

ることを規制することができる。これにより、歩き易くすることが可能になる。なお、下り傾斜部１１ｆの傾斜角度ｘは、０°＜ｘ≦９０°の範囲で設定可能であるが、傾斜が小さすぎると使用者の足裏の外側の移動量が小さくなり、膝の内側のねじれを元に戻す効果が得にくくなる。逆に、傾斜が大すぎると足裏に対して足台１０がずれ易くなり、歩きにくくなるおそれがある。このため、下り傾斜部１１ｆの傾斜は、３０°≦ｘ≦６０°の範囲であることが望ましい。

[0051] なお、使用者が、小指側欠落部１１ｃが対向している足裏の外側部分が地面に付かないように意識を持ちながら歩行することにより、使用者の脚の重心を内側に補正することが可能になり、使用者がＯ脚であれば、使用者の膝の間隔を狭くすることも可能である。

[0052] また、使用者が履物１を履いた場合に、鼻緒２０の内側横緒部２２ａが使用者の親指の付け根を通り、外側横緒部２２ｂが使用者の足の甲を通ることで、履物１が使用者の足から外れ難くなる。

[0053] また、前緒部２１が上り傾斜部１１ｄに配置されているため、上り傾斜部１１ｄの傾斜面上に使用者の親指及び人差し指及びその付け根が当接する。このため、使用者の足裏における親指及び人差し指及びその付け根の部分のみが、水平部１１ｅの上面よりも高く位置付けられる。

[0054] このように、使用者の足裏における親指、人差し指及びその付け根部分が他の部分よりも高い位置にあるため、踵側が下方に移動し易くなり、重心が後方に移動し易くなることで、使用者は前屈みになり難くなる。ここで、経時後に、背骨のラインが前方に傾いて使用者が前屈みになろうとしても、親指、人差し指及びその付け根部分が上り傾斜部１１ｄに載っているため前屈みになり難くなり、前屈みになっても背骨のラインを地面に対して直角方向に沿うように戻すことが可能になる。このように、使用者の姿勢を補正することが可能になる。

[0055] なお、前屈みになり難いことから、うつむき姿勢のような顔に重力がかかるような姿勢となる時間を短くすることができる。これにより、顔に水分が

集まってむくみが発生することが低減できるようになり、結果として、小顔効果も期待できる。更には、前屈みになり難くなって前傾姿勢を正してより良い姿勢に補正することにより、眼球を筋膜に押し付けることから解放することが可能になり、目の疲れを和らげることができる。他にも、前傾姿勢を正してより良い姿勢に補正することにより、歩く姿勢をよくする、足を上げ易くする、肩こりが低減される、首の後ろの血流をよくすることができる、といった効果を奏することができる。

[0056] また、第１の実施形態によれば、水平部１１ｅの上面から上り傾斜部１１ｄの傾斜面の頂上までの高さＨは７ｍｍ以上２２ｍｍ以下の範囲に設定されている。ここで、高さＨが低すぎると背骨のラインを後方に移動させ難くなり、逆に高すぎると通常の姿勢において背骨のラインを必要以上に後方に移動させるおそれがある。そこで、第１の実施形態のように、高さＨが７ｍｍ以上２２ｍｍ以下の範囲であれば、使用者が前傾姿勢になって背骨のラインが前方に傾いた場合に、背骨のライン後方に移動させて地面に対して真っ直ぐな状態に補正することが可能になる。より好ましくは、高さＨが１５ｍｍ以上２０ｍｍ以下に設定されていることにより、使用者が前傾姿勢になって背骨のラインが前方に傾いた場合に、安定して補正することが可能になる。

[0057] ところで、使用者の中には、踵側に重心をかけて歩く癖のある者（所謂、かかと歩きの者）もいれば、つま先側に重心をかけて歩く癖のある者（所謂、つま先歩きの者）もいる。かかと歩きの使用者は、踵が第２層１２の上面に付かないように歩くことを意識することによって、重心を前方に補正することが可能になる。また、つま先歩きの使用者は、踵を第２層１２の上面に着けるように歩くことにより、重心を後方に補正することが可能になる。このように、履物１は、かかと歩きの使用者の歩行姿勢も、つま先歩きの使用者の歩行姿勢も補正することができる。

[0058] また、踵欠落部１１ａによって形成される段差部分が弧状であるため、歩行の際に、弧状の踵部分に近い土踏まず付近を刺激することができる。また、第１層１１における踵欠落部１１ａと小指側欠落部１１ｃとの間の部分が

細く形成されているため、使用者が足裏の外側部分を上下動させることにより、土踏まずの側方を刺激することができる。これにより、足つぼを刺激することによる健康によい効果が期待できる。

[0059] また、上領域３１を下領域傾斜部３２ｂに沿うように変形させた状態で上領域３１の下面を下領域３２の上面に接着固定することによって、第１層１１に上り傾斜部１１ｄが形成される。このため、表面（上面）に凹凸等の滑り止めを形成する加工を施した上領域３１を下領域３２に接着固定することにより、上り傾斜部１１ｄの表面（上面）に凹凸等の滑り止めを形成した第１層１１を容易に作成することが可能になる。

[0060] また、上領域３１及び下領域３２は、互いに異なる色に着色されているため、履物１を側面視した場合に下領域３２がつま先側に向かって太くなっており、親指を載せる領域が高くなっていることを、使用者に視覚的に印象付けることが可能になる。

[0061] ［第２の実施形態］

図４は、本発明の第２の実施形態における履物２の外観を示す斜視図である。図５は、図４の平面図である。図６は、図４の側面図である。履物２は、所謂、ビーチサンダルであり、足台１０と、鼻緒２５と、を備えている。なお、図４～図６は、使用者の左足に履かせる履物２を示しており、右足に履かせる履物２は左足に履かせる履物２に対して左右対称であるため、右足に履かせる履物２についての詳細な説明は省略する。

[0062] 第２の実施形態における履物２は、図１～図３に示す第１の実施形態における履物１における鼻緒２０の代わりに鼻緒２５を足台１０に取り付けたものである。足台１０は、第１の実施形態と共通する。

[0063] 鼻緒２５は、鼻緒２０と同様に、例えば布や合成樹脂によって構成され、前緒部２６と、横緒部２７と、によって構成されている。前緒部２６は、足台１０の板面から上方に延びて、使用者の足の親指と人差し指とによって挟まれる部分であり、鼻緒２０と同様に第１層１１の上り傾斜部１１ｄに配置されている。横緒部２７は、紐状或いは帯状の部材によって構成されており

、前緒部２６の上端部を基端として足台１０における内側側部に向かって延びている。

[0064] 横緒部２７の終端は、第１層１１上における踵欠落部１１ａ側でかつ親指側の角部に固定される。つまり、鼻緒２５は、鼻緒２０から外側横緒部２２ｂを削除し、内側横緒部２２ａの終端を第１層１１上に配置したものである。

[0065] このように構成された第２の実施形態における履物２によれば、履物１と同様に、使用者が履物２を履いた場合に、使用者の足裏の小指側側部が、小指側欠落部１１ｃ、下り傾斜部１１ｆ及び踵欠落部１１ａに対向する。このとき、使用者の足裏の小指側側部が下方に移動し易い状態になるとともに、使用者の小指側の甲部に掛ける横緒部が無いため、使用者の足裏の小指側側部が第１層１１から離れ易くなる。このため、使用者は姿勢を維持しようとして、小趾外転筋等を使って足裏の土踏まず付近のアーチによって第１層１１をグリップしようとする。使用者が履物２を履くことによって、このようなグリップ動作を促すことが可能になり、その結果、骨格が正常になるような使用者の動きを誘導することが可能になる。

[0066] また、横緒部２７は、親指側の甲にかける一本のみであるが、終端が、第１層１１上に配置されており、比較的短くなっている。このため、横緒部２７を親指側の甲に確実にかけることが可能になる。これにより、歩行の際に、使用者の足裏から足台１０が離れる長さを小さくすることができ、歩行を安定させることが可能になる。

[0067] 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の実施形態は上述した実施形態に限るものではない。例えば、上述した実施形態は、ビーチサンダルを例として説明したが、草履に適用することも可能である。また、足板は、ゴム材やＥＶＡウレタン材等によって構成されているが、足板の材質はそれに限るものではない。例えば、木材で構成してもよい。

[0068] また、本発明の実施形態においては、足台１０が２層に形成されているが、足台における使用者の足裏におけるつま先側の外側半分が対向する部位及

び踵部分が対向する部位に、板厚を薄くした薄肉部を形成したものであれば、１層（単板）であってもよい。また、第１層１１及び第２層１２をそれぞれ複数層に構成してもよい。また、第１層１１も、２層構造で示したが、１層（単板）であってもよい。

符号の説明

[0069] １、２　履物

１０　足台

１１　第１層

１１ａ　踵欠落部

１１ｂ　つま先部

１１ｃ　小指側欠落部

１１ｄ　上り傾斜部

１１ｅ　水平部

１１ｆ　下り傾斜部

１２　第２層

１２ａ　踵側平坦部（踵薄肉部）

１２ｂ　小指側平坦部

１２ｂ１　小指側側部

２０、２５　鼻緒

２１、２６　前緒部

２２、２７　横緒部

２２ａ　内側横緒部

２２ｂ　外側横緒部

３１　上領域

３２　下領域

３２ａ　下領域水平部

３２ｂ　下領域傾斜部

請求の範囲

[請求項1] 足が載せられる足台（１０）を備え、前記足台（１０）は、使用者の踵に対向する部位の厚さを薄くした踵薄肉部（１２ａ）と、使用者の小指側に対向する部位の厚さを薄くした小指側薄肉部（１２ｂ、１１ｆ）と、前記踵薄肉部（１２ａ）及び前記小指側薄肉部（１２ｂ、１１ｆ）を除いた部位に形成され、使用者の足裏が載せられる載置部（１１ｂ）と、を有する履物であって、

前記小指側薄肉部（１２ｂ、１１ｆ）は、小指側平坦部（１２ｂ）と下り傾斜部（１１ｆ）とからなり、

前記小指側平坦部（１２ｂ）は、使用者が履物を履いた状態において、少なくとも使用者の足の薬指、小指及びこれらの付け根部分と、当該付け根部分に対して踵寄りに位置する母趾内転筋横頭の部分が対向する部位であり、

前記下り傾斜部（１１ｆ）は、使用者が履物を履いた状態において使用者の足裏の小趾外転筋が対向する部位であり、前記載置部（１１ｂ）の上面から前記小指側平坦部（１２ｂ）の上面に向かって下り傾斜しており、かつ、

前記小指側平坦部（１２ｂ）の上面と前記踵薄肉部（１２ａ）の上面とは連続していることを特徴とする履物。

[請求項2] 請求項１に記載した履物であって、

足の親指と人差し指とによって挟まれる前緒部（２１）及び足の甲にかける横緒部（２２）からなり、前記足台（１０）に取り付けられる鼻緒（２０）を、更に備えることを特徴とする履物。

[請求項3] 請求項２に記載した履物であって、

前記横緒部（２２）は、足の甲の小指側にかける外側横緒部（２２ｂ）と、足の甲の親指側にかける内側横緒部（２２ａ）とを有し、

前記外側横緒部（２２ｂ）及び前記内側横緒部（２２ａ）は、前記前緒部（２１）から延びて、端部が前記踵薄肉部（１２ａ）に取り付

けられることを特徴とする履物。

[請求項4] 請求項２に記載した履物であって、

前記横緒部（２２）は、前記前緒部（２１）から延びて足の甲の親指側にかけ、小指側にかけないことを特徴とする履物。

[請求項5] 請求項４に記載した履物であって、

前記横緒部（２２）の端部は、前記載置部（１１ｂ）に取り付けられることを特徴とする履物。